**Шипилова, Ольга Ивановна.**

**Ионные и плазменные источники для создания модифицированных слоев в диэлектриках : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08 / Шипилова Ольга Ивановна; [Место защиты: Нац. исслед. ядер. ун-т «МИФИ»]. - Иркутск, 2019. - 138 с. : ил.**

**Оглавление диссертациикандидат наук Шипилова Ольга Ивановна**

**Выводы к главе**

**ГЛАВА 3. ПУЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИОНОВ, ЭМИТИРУЕМЫЕ ВАКУУМНЫМИ РАЗРЯДАМИ**

**3.1. Параметры пучка ионов, эмитированного высоковольтным ионным имплантером типа MEVVA.RU**

**3.2. Параметры катодной плазменной струи низковольтного вакуумно-искрового разряда**

**Выводы к главе**

**ГЛАВА 4. ИСТОЧНИКИ ГАЗОВОЙ И ГАЗО-МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЛОЯ В**

**ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ**

**4.1. Исследования параметров магнетронного разряда**

**малой мощности**

**4.2. Исследования плазмы микроволнового разряда**

**Выводы к главе**

**ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПЛАЗМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЛОЕВ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ**

**СОЕДИНЕНИЙ**

**5.1 Характеристики слоев ЩГК, облученных пучками**

**металлических ионов**

**5.2. Характеристики модифицированных слоев ЫБ, полученных с помощью магнетронного разряда и путем облучения плазмой СВЧ-**

**разряда**

**Выводы к главе**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Список литературы**